

平成27年度採択 車載センサー向け高性能コーティング膜 製造用スパッタ装置の開発

株式会社広島（愛知県） 主たる技術：表面処理に関わる技術

高機能で成膜速度を向上させたHIPIMS電源を搭載した最新スパッタ装置の開発

研究開発の成果

- 装置の真空度 10^{-4} Paの到達
装置としてリークのない証明として真空度 10^{-4} Pa の到達を確認した。
- 成膜速度4倍
遷移領域制御をHIPIMSにて行うことで、行わなかったときより成膜速度を4倍にすることに成功した。
- プラズマ密度10倍
カソード付近のプラズマ密度を高くすることによりカソードに衝突するArイオンの数を上昇させ、成膜速度を早くし及び膜質の向上を行った。



研究体制

公益財団法人 科学技術交流財団

株式会社広島、株式会社ニデック、株式会社ペガサスソフトウェア、
名古屋市工業研究所

当該研究開発の連絡窓口

所属・氏名 (株)広島 國枝 洋尚

E-mail hirotaka_kunieda@hiroshima-web.com

電話番号：052-629-0020